PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 04-F-037PCT	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below		
International application No. PCT/JP2004/011025	International filing date (day/month/year) 27 July 2004 (27.07.2004)	Priority date (day/month/year) 29 July 2003 (29.07.2003)		
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237				
Applicant JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY				

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).				
2.	This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.				
	In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.				
3.	3. This report contains indications relating to the following items:				
	Box No. I	Basis of the report			
	Box No. Π	Priority			
	Box No. III	Non-establishment of opin applicability	ion with regard to novelty, inventive step and industrial		
	Box No. IV	Lack of unity of invention			
	Box No. V	Reasoned statement under applicability; citations and	Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial explanations supporting such statement		
	Box No. VI	Certain documents cited			
	Box No. VII	Certain defects in the inter-	national application		
	Box No. VIII	Certain observations on the	international application		
4.	4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).				
-					
_			Date of issuance of this report 30 January 2006 (30.01.2006)		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes		mbettes	Authorized officer Yoshiko Kuwahara		
1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 740 14 35		ner ditt	Telephone No. +41 22 338 90 90		

Form PCT/IB/373 (January 2004)

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出頭人代理人 西澤 利夫 あて名 〒107-0062 東京都港区南斉山6丁目11番1号 スリーエフ南 守山ビルディング7F	REC'D 11 NOV 2004 PCT PCT 国際認金機関の見解費 (法施行規則第40条の2) (PCT規則43の2.1) 発送日 (日.月.年) 09.11.2004				
出題人又は代理人 の答類記号 04-F-037PCT	今後の手続きについては、下記2を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP2004/011025 (日.月.年) 27.	07.2004 (日.月.年) 29.07.2003				
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. H01L21/3065					
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構					
1. この見解替は次の内容を含む。					
見25年を作成した日					

見 2 2 . 1 2 2 . 1	0.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 今井 拓也	4R 3339
郵便番号100-8915 東京都千代田区貿が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内部	泉 3469

第1欄 見解の基礎						
1. この見解費は、下記に示す場合を除くほか、国際出題の言語を基礎として作成された。						
この見解告は、						
	2. この国際出頭で開示されかつ暗求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解寄を作成した。					
a. タイプ	□ 配列表					
	記列表に関連するテーブル					
b. フォーマット	一 春面					
	□ コンピュータ読み取り可能な形式					
c. 提出時期	出頭時の国際出頭に含まれる					
•	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された					
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された					
3. さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。						
4. 補足意見:	•					
•	·					

第Ⅲ 粉
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
□ 国際出頭全体
× 請求の範囲
理由: この国際出際又は請求の範囲
,
図 明細盤、簡求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は簡求の範囲 12、13、16,17 の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
※ 全部の請求の範囲又は請求の範囲
X
□ ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が、実施細則の附属書C (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン) に定める基準を、次の点で満たしていない。
書面による配列表が
所定の基準を満たしていない。 コンピュータ読み取り可能な形式による配列表が 提出されていない。
□ コンピュータ読み取り可能な形式によるヌクレオチド又はアミノ酸の配列表に関連するテーブルが、実施細則の附属部 Cの2に定める技術的な要件を、次の点で満たしていない。
□ 提出されていない。 □ 所定の技術的な要件を満たしていない。
詳細については補充相を参照すること。

2. 文献及び説明

国際調査報告で引用された文献

文献1:In-situ observation of surface blistering in silicon by deuterium and helium ion irradiation.

Surface and Coatings Technology. September 2002, vol. 158-159, pages 421-425

文献 2:Koji Nakayama and J.H.Weaver. Electron-Stimulated Modification of Si Surface. Physical Review Letters. February 1999, vol. 82, No. 5, pages 980-983

請求の範囲1-11、14、15、18、19

文献1は、当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であって、重水素イオンまたはヘリウムをシリコン表面に照射しブリスターを形成することが記載されている。

文献 2 は、当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であって、電子線照射によりシリコン表面に欠陥が生成することが記載されている。

しかし、電子線またはイオン照射することによりブリスターを破壊する技術に関しては、記載も示唆もない。

第VII 国際出願に対する意見

請求の箆囲、明知杏及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細杏による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲12に記載の表面構成原子の原子種のパターンは、もたらされる結果により発明を特定しようとするものであるが、明細書には具体的なものが一切記載されていないから、PCT第5条の意味での開示を欠き、また、PCT第6条の意味での明細書の開示による裏付けを欠いている。

請求の範囲13に記載の表面より下層の成膜の違いのパターンであることは、意味が不明確であるから、PCT第6条における明確性の要件を欠いている。

請求の範囲16に記載の親和性パターンであることは、明細書には具体的なものが一切記載されていないから、PCT第5条の意味での開示を欠き、PCT第6条の意味での明細書の開示による裏付けを欠いている。

請求の範囲17に記載の親水性または疎水性のパターンであることは、明細書には具体的なものが一切記載されていないから、PCT第5条の意味での開示を欠き、PCT第6条の意味での明細書の開示による裏付けを欠いている。